水素分子吸蔵へ向けた分子設計

(九州大情基セ1・京都大福井セ2・レブデフ物理研3・分子研4) ○南部伸孝¹, 石田俊正², Alexey D. Kondorskiy³, 中村宏樹⁴

[序] 非断熱遷移は分子機能を呼び起こしさらに、制御す るための鍵となる現象と考えられる。我々はこれまで, 周期的な非断熱トンネル型交差二準位ポテンシャルを持 つ系に表れる完全透過現象と完全反射現象を利用した分 子スイッチの可能性をモデルではあるが、追求してきた. [1-4] さらに最近では、より現実的な系としてカーボ ンナノチューブやフラーレンによる原子のカプセル化の モデルになりうる環状分子の水素原子による環透過性に 関する新たな提案を行っている. [5] 特に、コランニュ レン及びコロネン分子を用い、中心に存在する5員環及 び6員環を透過させるために電子状態をどのように変え

るかが鍵となる.一般に、炭素面はかなり安定な ため、ファンデルワールス力による小さな井戸が 面の前には存在するが,一応に反発型のポテンシ ャルとなる. そこで、我々は活性を上げるため、 ホウ素置換やフッ素原子を付加する方法を提案 してきた. しかしながらその一方で、水素原子の 吸蔵を対象としてきたため, 水素分子ではどうな るか?という疑問が残る. 本研究では、水素分子 での可能性を探索した結果を報告する.

[計算方法] 基底関数には Dunning らの cc-pVDZ 関数を用い, 状態平均を取りながら多配置参照 SCF 計算により分子軌道を決定した. 求めた分子 軌道を用い配置換相互作用計算を行い, 反応に関 連する電子励起状態のポテンシャルエネルギー 曲線を決定した. 得られたポテンシャルを基に透 熱ポテンシャルを決定し, R 行列伝播法を用い, 水素原子の透過確率を求めた.

[結果と考察] これまで、主に炭素フラーレンやナノ チューブを対象に水素原子透過過程を探索してきた. しかし、水素原子を水素分子に置き換えた場合、幾 ら活性を上げるためにホウ素置換等を実施しても, ほ ぼすべての場合において、反発型ポテンシャルとなり、非断熱遷移過程を人工的に作ることができな

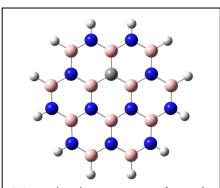


図 1:(BN)₁₁BCH₁₂ モデル, 青 色:窒素,灰色:炭素,ピンク: ホウ素,白:水素

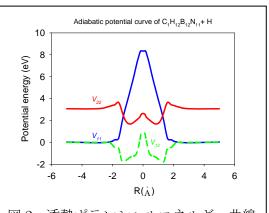
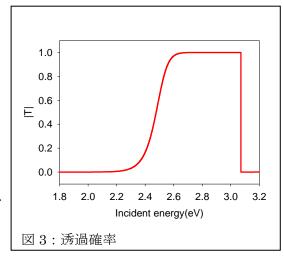


図2: 透熱ポテンシャルエネルギー曲線



かった. 一方これまでの研究に おいて水素原子の透過過程で はあるが,窒化ホウ素ナノチュ ーブ(BNNT)のモデルにおいて は偶然,たった一つの窒素を炭 素への置換することによって非 断熱遷移を人工的に引き起こ すことも見出している. これは炭 素フラーレンやナノチューブで

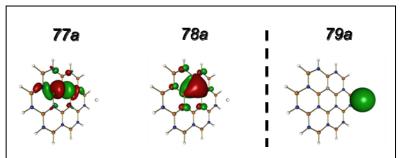


図 4:解離極限における SOMO 付近の分子軌道, 78a と 79a にそれぞれ電子が一個詰まった状態となる.

は見られない現象である. その結果を図1, 2, 3, 4に示す. 図3よりこの系は純粋トンネル現象により水素原子が透過することが分かった. 理由は図 2 に示す通り, 透熱結合要素 (緑の破線)が大きな値を持つため, 励起状態に現れるべき 擬交差による井戸ができないことに起因する. さらに, 図4 に示す分子軌道を見ると明らかに, 今までとは異なる電子 状態となっている. 因みにこれまでは, ヒュッケル則を満たさない不安定な電子状態を生成することにより, 非断熱遷移を引き起こして来た. ところが, この系ではイオン結合を直接生成することに成功している. 具体的には 79a 分子軌道から 78a 分子軌道への一電子励起のみで記述されている.

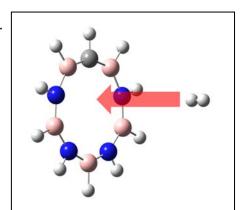
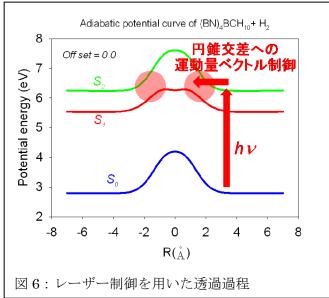


図 5:BN 結合を用いた 10 員環 への水素分子透過経路の模式図

このような結果を踏まえ、BNNTでは比較的容易にイオン結合を作ることが可能と考え、まず簡単な系において水素分子を応用した.



報告する. 本講演では、BNNT の小型モデルを基に炭素原子置換を行い、励起状態を実現可能領域まで下げるデザインともに新提案果を報告する.

[参考文献] [1] Nakamura, J. Chem. Phys. 97, 256 (1992); [2] Nanbu, Nakamura, Goodman, J. Chem. Phys. 107, 5445 (1997); [3] Nakamura, J. Chem. Phys. 110, 10253 (1999); [4] Nakamura, "Nonadiabatic Transition" World Scientific; [5] Nanbu, Ishida, Nakamura, Chem. Phys. 324, 721-732 (2006).